

2023年3月期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

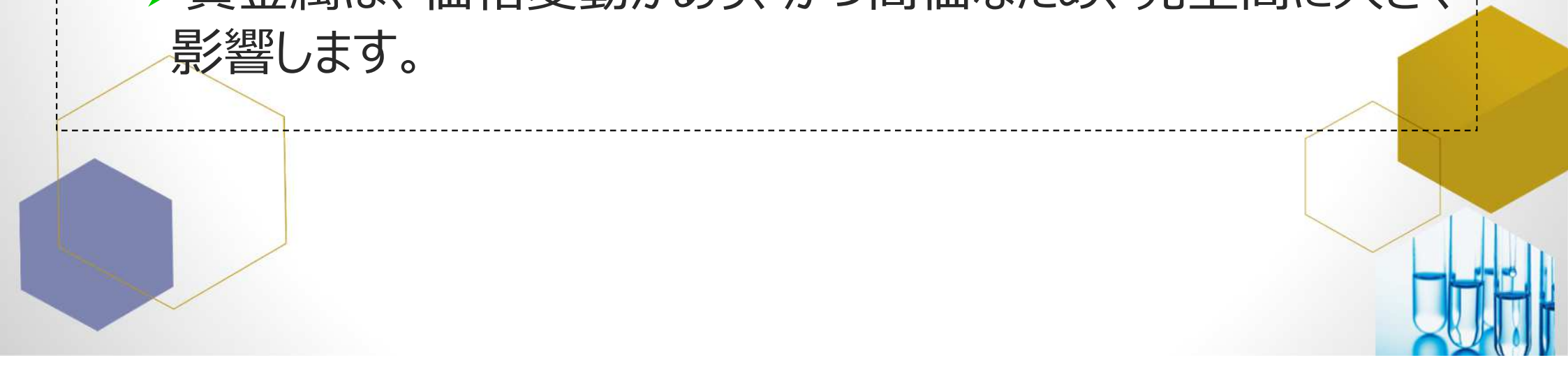
2023年4月26日





決算の概況

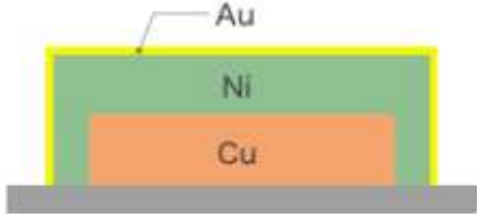
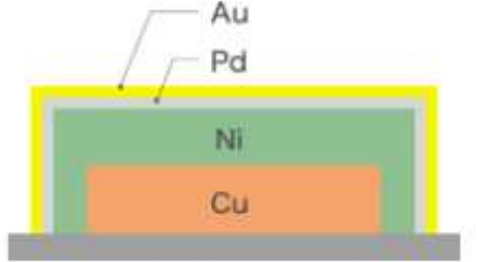
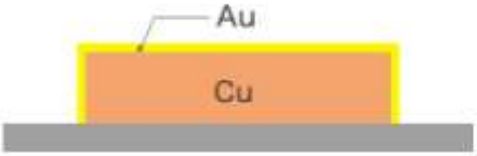
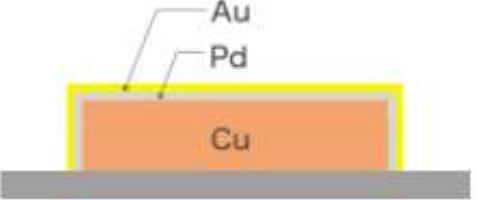
(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
 - 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

用語説明①（めっき方式）

用語	用途	説明
電解めっき (電気めっき)	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクタ プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム (Pd) めっき	リードフレーム コネクタ	金めっきの下地めっきとして使用される PPFはPre Plated Lead frameの略
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法

用語説明②（めっきプロセス）

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法 Electroless Nickel Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Au	
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Pd-Au	
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Pd-Au	

製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

	めっき方式	用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd)		PPF用薄膜パラジウムめっき	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	

新分野

卑金属（銅、スズ、ニッケル）
合金めっき 後処理剤など

2023年3月期の概況

電子部品業界の状況

- インフレに伴う原材料の高騰や世界的な景気減速などの影響によりクラウド／データセンター向けで投資抑制に伴う生産調整が見られ需要が低迷
- コロナ禍で積み増していた在庫の適正化によりスマートフォンやパソコン向け電子部品は生産量が減少
- 車載用電子部品については、自動車の電装化や電気自動車へのシフトに伴う需要増に対して、サプライチェーンの問題から一部の半導体で依然供給不足を解消することができず、自動車の生産調整が長期化も緩やかな回復基調

当社決算の概況

- プリント基板・半導体製品搭載基板用めっき薬品
→第2四半期から引き続き、スマートフォン、パソコン、クラウド／データセンター用途の不振によるメモリ用途等での減産の影響を受け販売が低迷
- コネクタ用めっき薬品
→産業機器や車載向けで堅調に推移したものの、スマートフォン向けの減産の影響を補うには至らず
- リードフレーム用めっき薬品
→スマートフォンやパソコン用途の減産の影響を受け販売が低迷し、加えてパラジウム価格の下落により減収

2023年3月期 決算概況

(単位：百万円、%)

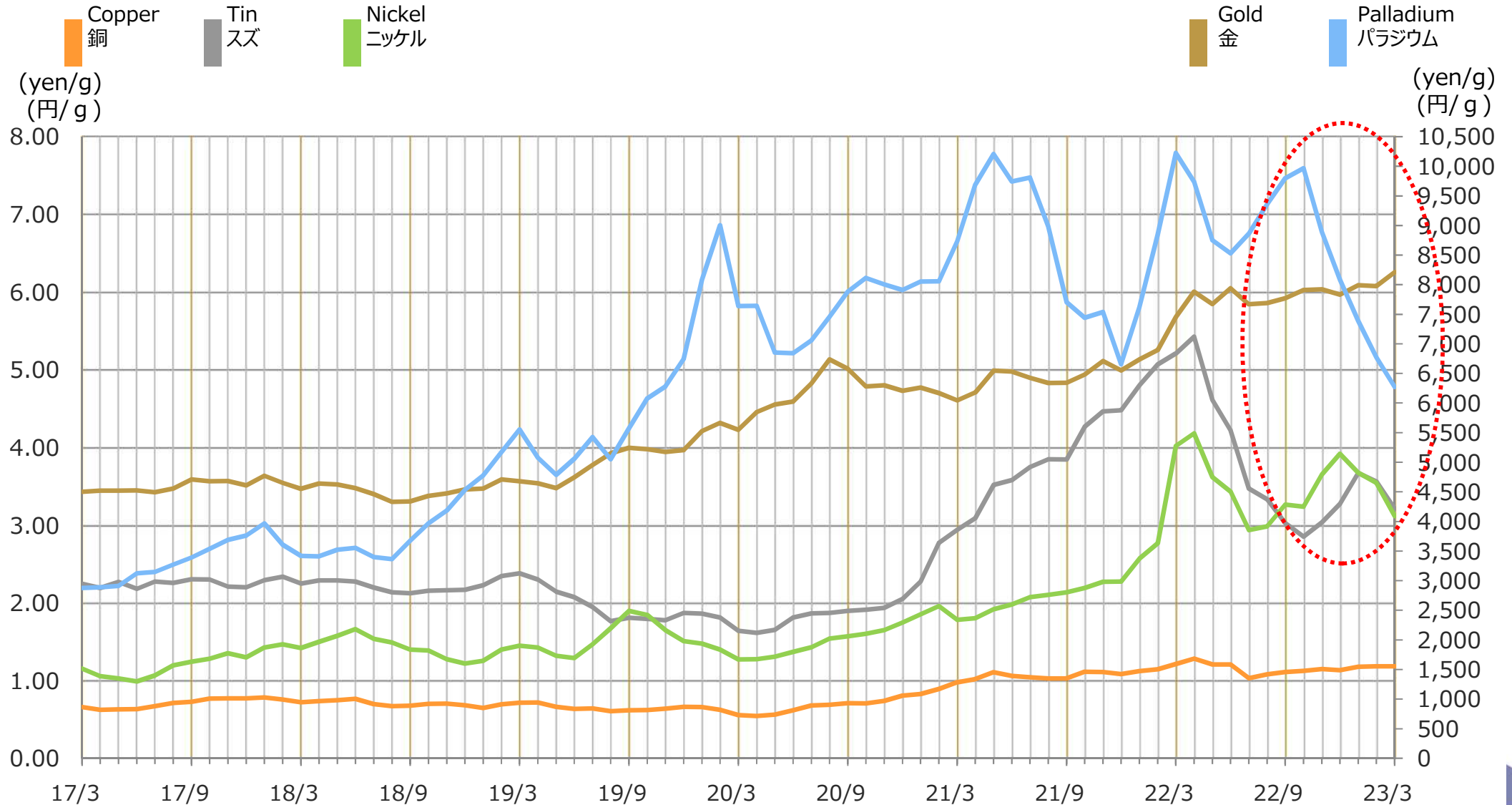
	2022/3期	2023/3期						増減率
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計		
売上高	18,714	5,050	4,004	4,092	3,108	16,254	△13.1	
営業利益	1,201	282	137	95	53	567	△52.8	
経常利益	1,339	374	143	178	57	753	△43.7	
四半期純利益	974	278	102	115	73	569	△41.5	
1株当たり 四半期純利益	166.80円	47.52円	17.45円	19.89円	12.76円	97.82円	—	

- 4Qにかけてスマートフォン、PC等の需要減及びメモリー等の在庫調整が計画以上に長期化
- 主力のメモリー用途のプリント基板及びコネクタの出荷減の影響が大きく、前期比で売上高△13%、営業利益△53%、経常利益△44%の減収減益

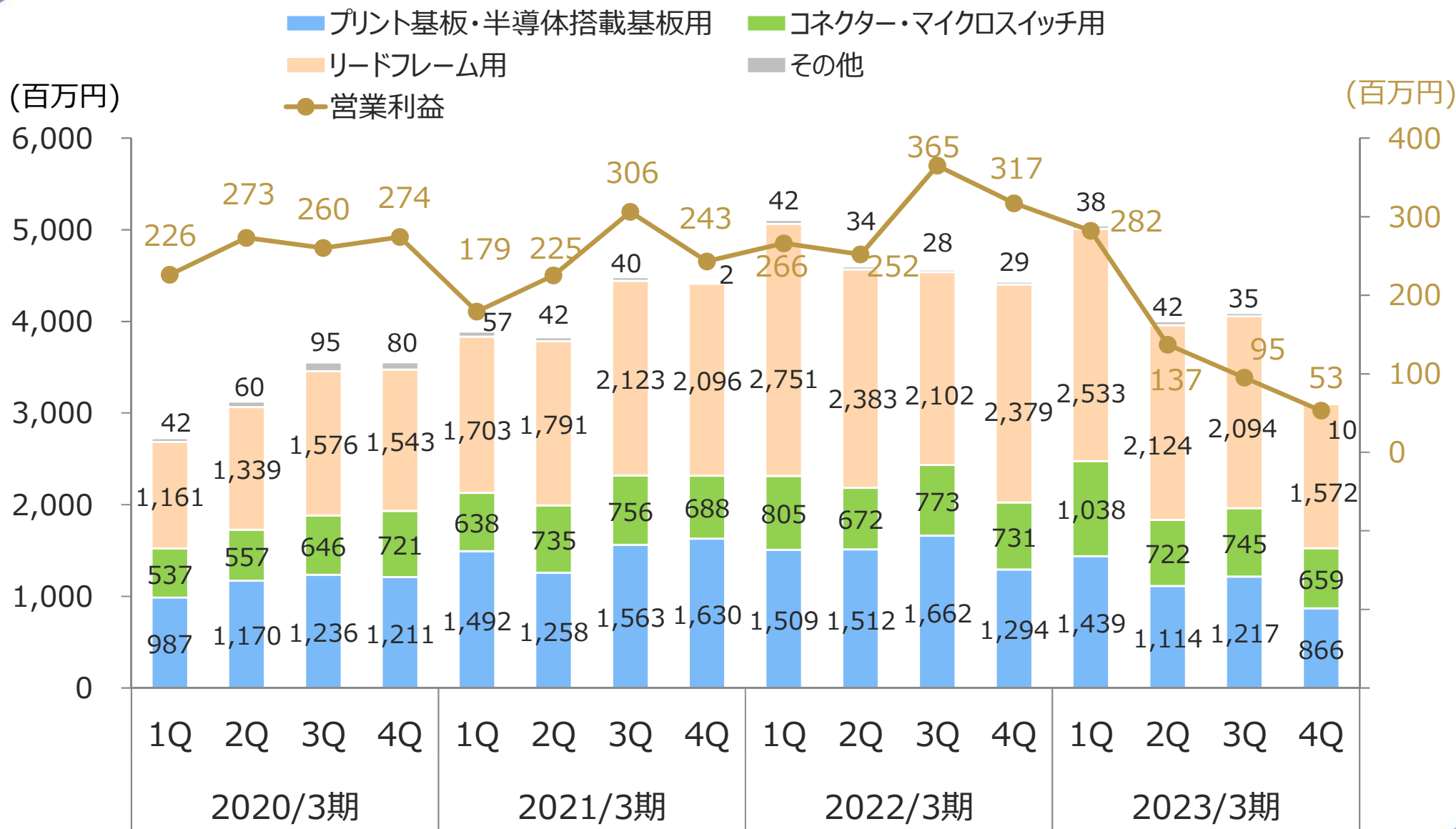
メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

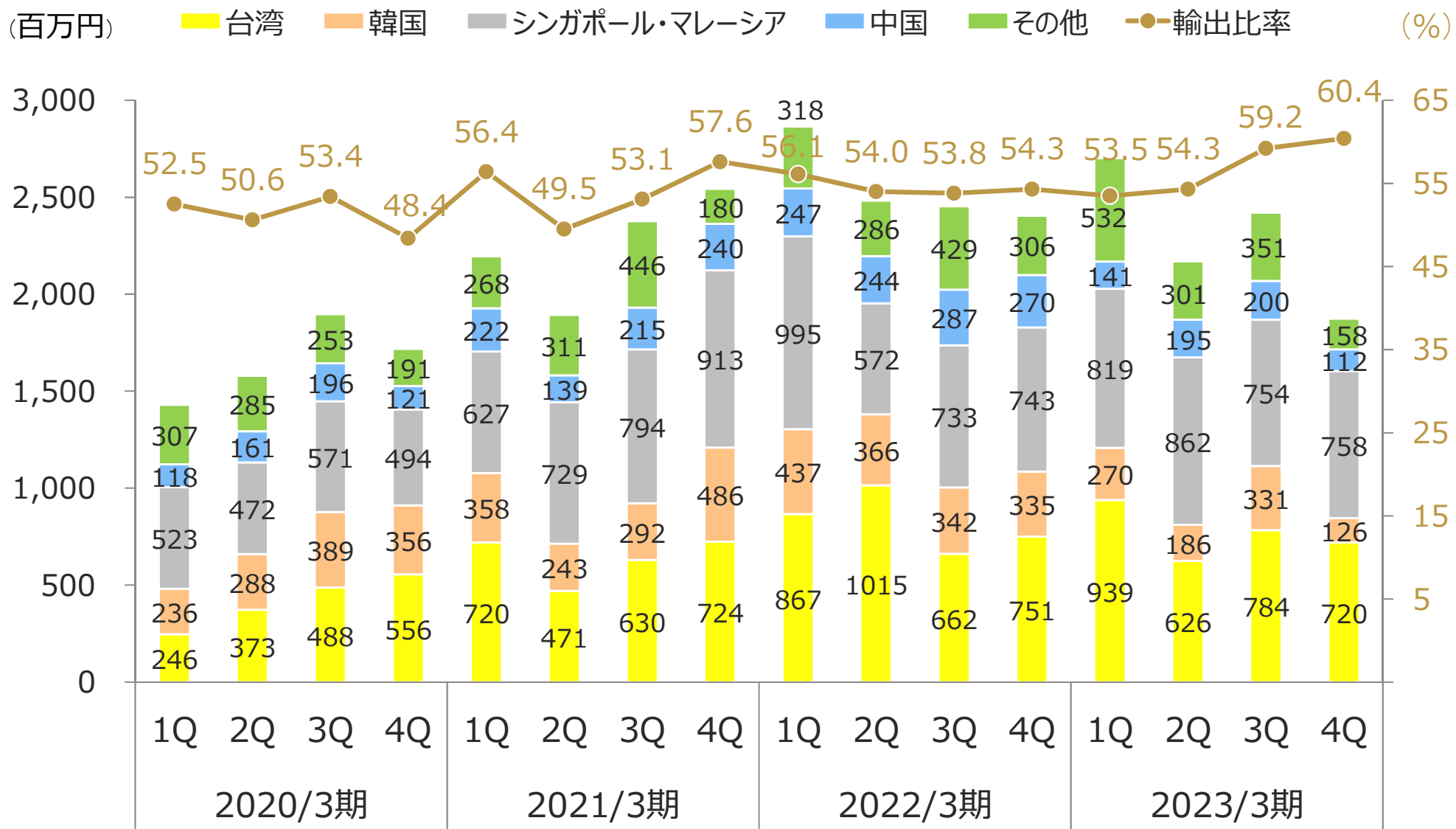
Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格



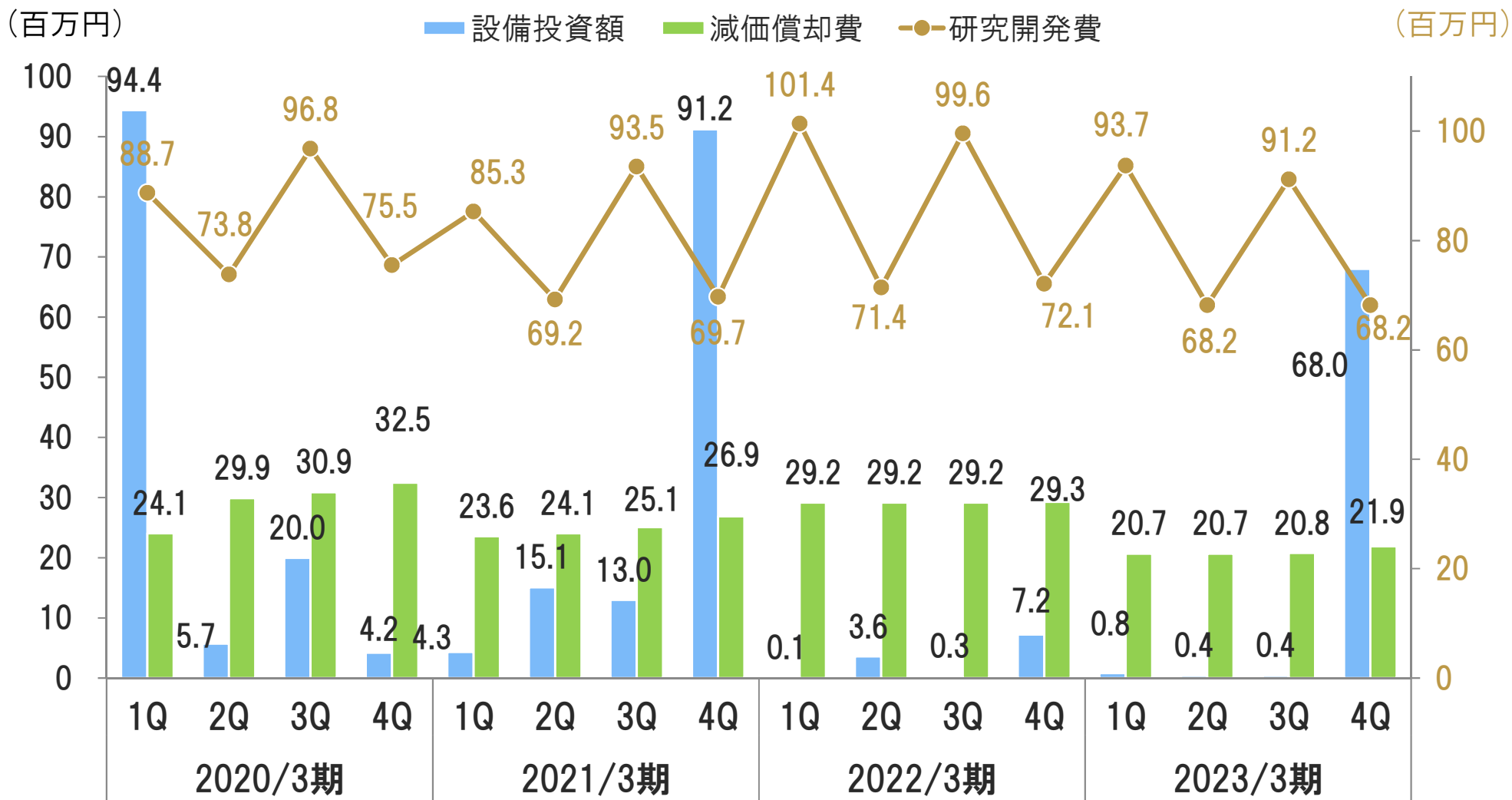
売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



- 2023/3期の主な投資 : ナノテラスの会員加入 50百万円
- 2024/3期の主な投資予定 : 研究開発用途設備投資 100百万円 (概算)

2024年3月期の見通し

(単位：百万円、%)

	2023/3期		2024/3期	
		前期比増減		前期比増減
売上高	16,254	△13.1	16,500	1.5
営業利益	567	△52.8	700	23.3
経常利益	753	△43.7	850	12.8
当期純利益	569	△41.5	600	5.3
配当	80円		80円	

- 設備投資や消費の低迷の影響により、上期は引き続き電子部品の需要は低調に推移することが予想されるものの、スマートフォンやデータセンター関連でメモリ等の需要は緩やかに回復すると期待され、プリント基板・半導体搭載基板用、コネクタ用、およびリードフレーム用めっき薬品の期後半からの需要回復を見込む

- 車載用電子部品については、自動車の生産調整に影響を及ぼしている半導体不足の解消により、該当めっき薬品の需要回復を見込む

- 年間では2023年3月期と比べて若干の好転の見通し

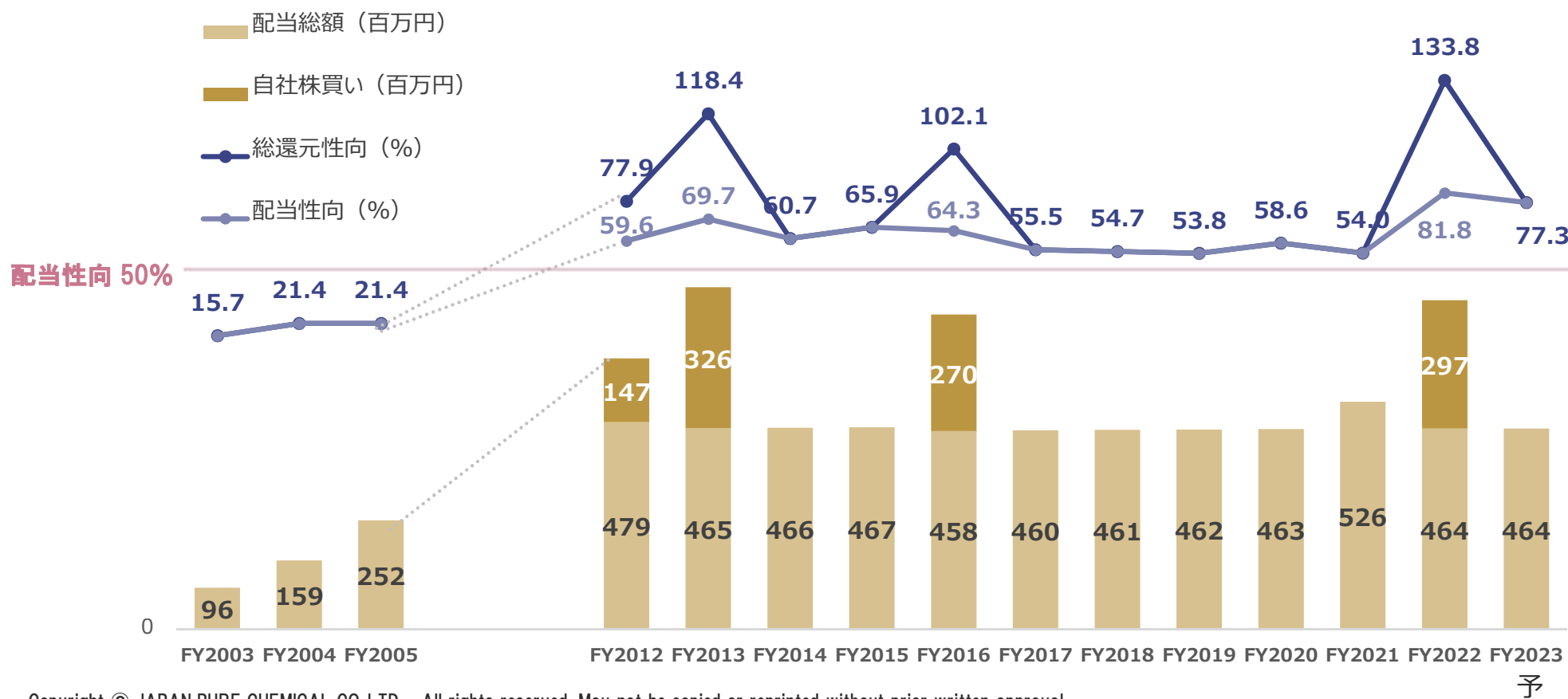
株主還元

基本方針（FY2022-2024）

- 長期的な成長を目指して、資本効率と財務健全性のバランスを取る
- 業績及び将来の事業展開と経営基盤強化に必要な内部留保資金等を総合的に勘案して継続して安定した配当を目指す
- 今後は安定配当のため、配当性向に加え DOE（純資産配当率）も考慮した配当政策を検討中
- 自己株式の取得についても状況に応じて、機動的に実施を検討する

配当性向・自社株買い・総還元性向の推移

※百万円以下切り捨て



企業理念とビジョン

企業理念

化学の好奇心でエレクトロニクスに役立てる

ファインケミカルとエレクトロニクスの架け橋となり
独創的な製品でグローバルに社会貢献する

ビジョン

RDD2030

社会課題と向き合い、多様な視点と独自の発想力を発揮し
エレクトロニクス業界を牽引するファインケミカル企業となる

RDD2030 Redox技術を電池材料に!!

Team JPCで一丸となり、めっきで培った酸化還元の世界で付加価値を創造する

RDD2030

Redox-innovation through **D**iscovery & **D**evelopment toward **2030**

中期経営計画

中期経営計画 FY2022-2024

開発型企業として、市場のニーズを収集し
独創的な製品開発につなげる

Redox : レドックス、reduction/oxidationの混成語で酸化還元の意

中期経営計画のロードマップ

Redox-innovation through **D**iscovery & **D**evelopment toward **2030**

RDD2030

Redox技術を電池材料に!!

Team JPCで一丸となり、めっきで培った酸化還元の世界で付加価値を創造する



- 新しい事業領域の創出（技術投資）
- DXによる取引先の深化（営業投資）

サステナビリティ経営に向けた取り組み
能動型自律人材の採用と育成

既存分野の新規開拓施策（進捗状況）

トップニュース

【ニッケル不使用プロセス(DIG・EPIG)】

次世代パッケージ技術において微細配線および良好な高速/高周波特性が求められており、当社プロセスの評価機会が増えてきている

→次期の取組み：顧客との実用性や性能評価を進める

1 認知度向上

展示会・広告等を活用し、知名度が低い市場、国内外での認知度向上

ネプコンショー、二次電池展に出展（弊社ブースに述べ500名が来場）

→次期の取組み：海外の展示会(SEMICON CHINA, ELECTRONICA)に出展し、グローバルな認知度向上を目指す

2 環境対応型製品の提案

シアン・毒劇物不使用、省資源プロセスの提案

シアン・劇毒物不使用製品の拡販活動実施中

→次期の取組み：評価用装置を導入し、顧客との実用性実証評価を積極的に進め、採用に繋げる

3 トータルプロセスでの性能向上提案

協業により、装置・前処理・後処理を含んだトータルプロセスでの性能向上

協業先選定に向けた戦略策定、社内アセスメント実施。

→次期の取組み：協業体制を構築し、トータルプロセス提案による拡販活動に着手

新しい事業領域の創出

- 二次電池展に出展し、要素技術の紹介
 - 大手電子部品メーカーを含め、約400社との新たな接点
 - 既存分野に繋がる新たな顧客チャンネルを獲得
 - デンドライト抑制技術やナノコロイド創製といった要素技術を幅広いメーカーに紹介
- 3 GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu」(ナノテラス) のコアリション会員加入



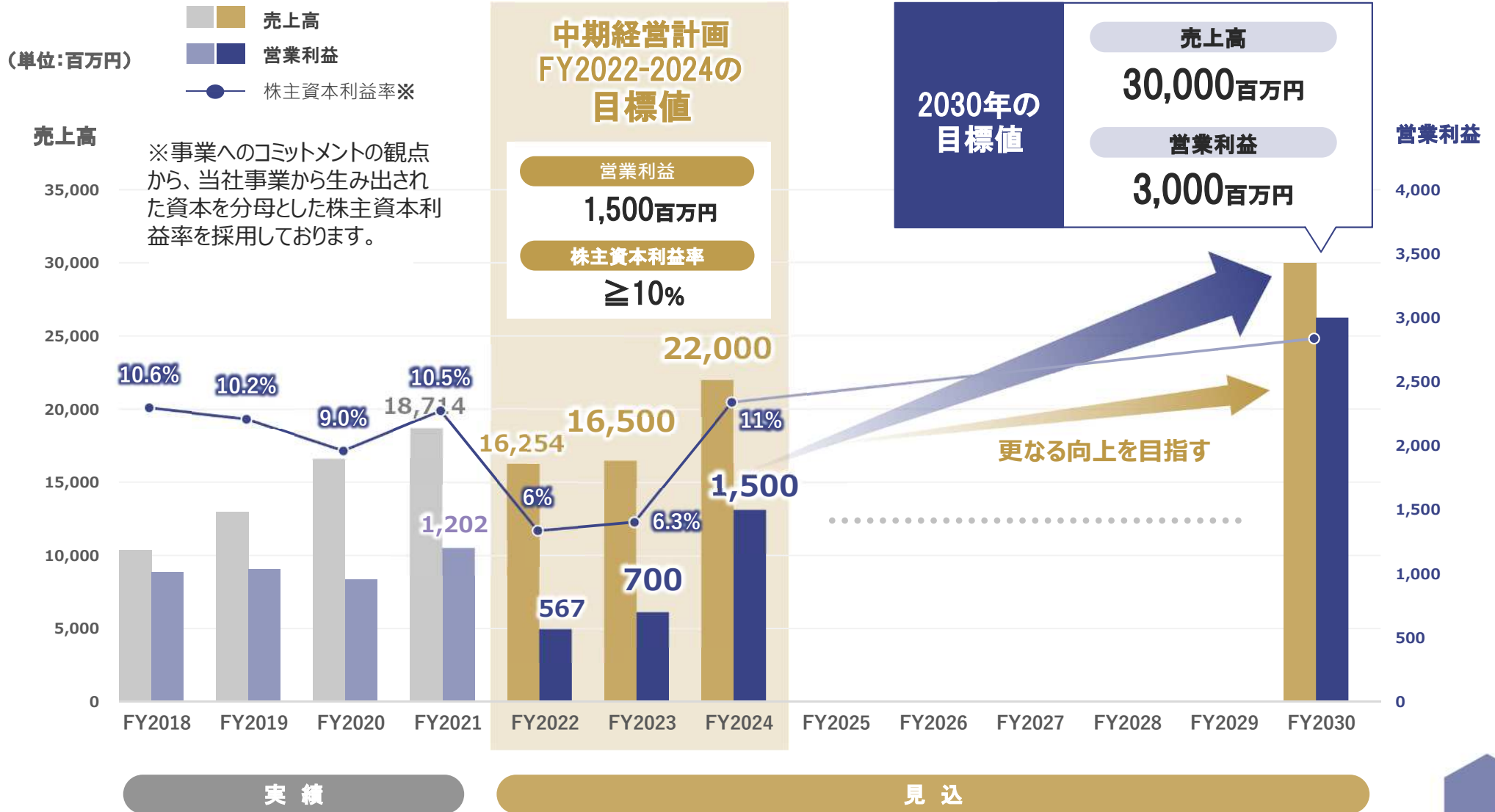
[弊社お知らせへのリンク](https://ssl4.eir-parts.net/doc/4973/tdnet/2258603/00.pdf)

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/4973/tdnet/2258603/00.pdf>

(一財)光科学イノベーションセンター提供

数値目標

既存分野の新規開拓を主軸として継続した営業利益の拡大と株主資本利益率の向上を目指す



売上高に含まれる貴金属の価格変動がない前提

財務方針

- 堅調な業績により3年で25億の営業CFを創出し、「既存事業への投資」と「安定的な株主還元」に配分
- 中長期の成長投資に向けては、潤沢な手元資金と政策保有株式の流動化を活用

CASH-OUT	通常投資 FY2022~24	成長投資 FY2023~27
(1) 既存事業の成長に向けた投資 既存ビジネスの成長：インフラ強化、拡販投資	5億	
(2) 戦略投資枠の設定 M & Aの検討 技術施設（開発 & 製造）の拡張・増強 電池材料関連のR & D（出資・CVC等を含む）		40~50億 5~10億 5~20億
(3) 安定した株主還元の実施 配当 機動的な自社株買い	15~18億 3~5億	
	23~28億	50~80億

CASH-IN		
(1) 堅調な業績による営業キャッシュフローの創出	25億	
(2) 運転資金を超過した現預金		20億
(3) 保有株式の流動化		20億~40億
(4) 外部からの資金調達		10億~20億
	25億	50~80億




政策保有株式は中長期の成長に向けた投資計画の原資として、活用を進めていく⇒縮減の方向

サステナビリティ基本方針

- 当社は**貴金属や希少鉱物を使用する製造業であり、多くの化学物質を取り扱う事業の性質上、地球環境への配慮が不可欠です。**資源を有効活用し、持続可能な社会づくりに貢献することを前提として事業活動を行い、環境負荷を継続的に低減していきます。
- 当社は「**化学の好奇心でエレクトロニクスに役立てる**」の企業理念のもと、**地球環境リスクやライフスタイルの変革、エネルギーシフト等の社会課題と向き合い、ステークホルダーとの連携を深め、多様な視点と独創性を発揮しながらファインケミカルとエレクトロニクスの架け橋となることを目指します。**
- 当社はサステナビリティを巡る重要課題（マテリアリティ）が、**事業のリスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題として認識し、これらの課題に真摯に取り組めます。**当社は、当社事業を通じた社会の持続可能な発展への貢献と共に持続的な成長と企業価値向上を目指します。

サステナビリティへの取り組み

環境変化に敏感に対応し、公正な企業活動を進めることで 持続可能な社会の実現に貢献していく

目標	具体的な取り組み	関連するSDGs
<div data-bbox="185 555 347 711"> <p>E 環境</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 環境に優しい製品作り ● 穀物由来原料の代替 ● CO₂削減 	<ul style="list-style-type: none"> ● シアンフリー金めつき薬品の開発 ● 穀物由来原料の使用量を削減し世界食糧問題へ貢献 ● エネルギー使用量・廃棄物量の削減、梱包プラスチックの減容化 	
<div data-bbox="185 890 347 1046"> <p>S 社会</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 多様な中核人材の採用と育成 ● 働く環境の整備 ● 社員報奨制度 ● 奨学金助成（財団）の拡充 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現場施策に連動した人材採用 ● 能動型自律人材教育プログラム ● 健康経営優良法人の認定 ● 全社員参加型の新テーマ推進制度 	
<div data-bbox="185 1228 347 1385"> <p>G ガバナンス</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 経営のモニタリング強化 ● ステークホルダーへの情報発信 ● コンプライアンスの徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ● 社外役員・執行部門が一体化したコーポレートガバナンス推進 ● 企業調査レポート活用による当社独自性・成長可能性のアピール ● BCPの見直し ● 情報セキュリティの強化 	

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2023年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>